PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11)Publication number:

04-034000

(43) Date of publication of application: 05.02.1992

(51)Int.CI.

C11D 7/50 B23K 1/00

C11D 7/26

(21)Application number: 02-140845

(71)Applicant: HITACHI LTD

HITACHI VLSI ENG CORP

(22)Date of filing:

30.05.1990

(72)Inventor: KIKUCHI HIROSHI

KIKUCHI NORISHIGE

HAYASHIDA TETSUYA SATO TOSHIHIKO TATE HIROSHI

(54) FLUX CLEANSER AND METHOD FOR CLEANSING SOLDERED ELECTRONIC PART WITH THE SAME (57)Abstract:

PURPOSE: To provide a cleanser substantially not having a smell, having a high flash point and capable of effectively and rapidly cleansing a flux adhered to soldered electronic parts by compounding benzyl alcohol. CONSTITUTION: A soldered electronic part is preferably immersed in a benzyl alcohol and heated or vibrated with ultrasonic waves to dissolve a rosin flux in the benzyl alcohol. The electronic part is subsequently immersed in isopropyl alcohol (IPA) to dissolve a white residue, tin abietate, in the IPA. The benzyl alcohol adhered to the surface of the electronic part is rapidly removed by the vapor-drying of the IPA.

LEGAL STATUS

[Date of request for examination]

[Date of sending the examiner's decision of rejection]

[Kind of final disposal of application other than the examiner's decision of rejection or application converted registration]

[Date of final disposal for application]

[Patent number]

[Date of registration]

[Number of appeal against examiner's decision of rejection

[Date of requesting appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of extinction of right]

BEST AVAILABLE COPY

Copyright (C); 1998,2003 Japan Patent Office

⑩日本国特許庁(JP)

① 特許出願公開

⑫公開特許公報(A) 平4-34000

®Int. Cl. 5

識別記号

庁内整理番号

43公開 平成4年(1992)2月5日

C 11 D 7/50 B 23 K C 11 D 1/00 7/26

8827-4H Y 9154-4E 8827-4H

審査請求 未請求 請求項の数 5 (全6頁)

60発明の名称

フラックス洗浄剤およびそれを用いた半田付け電子部品の洗浄方法

願 平2-140845 20特

大和

22出 願 平2(1990)5月30日

菊 地 @発 明 者

広 東京都青梅市今井2326番地 株式会社日立製作所デバイス

開発センタ内

@発 明 者 地 哲 慈 東京都小平市上水本町5丁目20番1号 日立超エル・エ

ス・アイ・エンジニアリング株式会社内

勿出 願 株式会社日立製作所 人 願 日立超エル・エス・ア の出

イ・エンジニアリング

東京都千代田区神田駿河台4丁目6番地 東京都小平市上水本町5丁目20番1号

株式会社

個代 理 人 弁理士 简 井

最終頁に続く

1. 発明の名称

フラックス洗浄剤およびそれを用いた半田付け 電子部品の洗浄方法

- 2. 特許請求の範囲
 - 1. ペンジルアルコールからなるフラックス洗浄 剤。
 - 2. 半田付け後の電子部品をペンジルアルコール 中に浸漬することを特徴とする半田付け電子部 品の洗浄方法。
 - 3. ペンジルアルコールを加熱または超音波振動 させることを特徴とする請求項2記載の半田付 け電子部品の洗浄方法。
 - 4. 電子部品をペンジルアルコール中に浸漬した 後、または電子部品をペンジルアルコール中に 浸漬するに先立ち、イソプロピルアルコール中 に浸漬することを特徴とする請求項2記載の半 田付け電子部品の洗浄方法。
 - 5. フラックス洗浄後の電子配品をイソプロビル アルコールで蒸気乾燥することを特徴とする論

求項2記載の半田付け電子部品の洗浄方法。

3. 発明の詳細な説明

〔産業上の利用分野〕

本発明は、半田付け電子部品のフラックス洗浄 技術に関するものである。

〔従来の技術〕

LSIパッケージを基板に実装する場合などの ように、一般に電子部品の半田付け工程では、フ ラックスが使用されている。上記フラックスは、 半田の姿面の酸化膜を除去したり、半田の再酸化 を防止したりする目的で使用されるが、反面、そ の中に含まれるイオン性物質が配線腐食や電気絶 録性の劣化を引き起こすため、半田付けが完了し た後は、半田付け箇所を充分に洗浄してフラック ス残権を除去する必要がある。

ところが、フラックス残渣を除去する洗浄剤と して従来広く使用されてきたクロロフルオロカー ポン (フロン) は、環境保護の見地からその使用 が規制されつつあるため、これに代わる新たな洗 伊利の開発が急務となっている。これまでに開発

されたフロン代替洗浄剤の主なものには、テルベン系洗浄剤、炭化水素系洗浄剤などがある。その他、鹼化剤を用いて半田付け後の電子部品を水洗する方法なども提案されている。なお、電子部品のフラックス洗浄技術については、工業調査会、平成元年9月1日発行の「電子材料」P21~P52に記載されている。

[発明が解決しようとする課題]

見地からも取り扱いが容易で、安全性が高い。さらに、鹼化剤を用いて電子部品を水洗する洗浄方法のように、洗浄後の電子部品の表面にPbが残留する嗅れもなく、Pbを回収するための排水処理設備も不要である。

という問題がある。また、洗浄水中に溶解した P b を回収するための排水処理設備が必要になるという問題もある。

本発明の目的は、上記した従来技術の問題点を改善したフラックス洗浄技術を提供することにある。

本発明の前記ならびにその他の目的と新規な特徴は、本明細書の記述から明らかになるであろう。
(問題点を解決するための手段)

ベンジルアルコールは、フラックス、特に電子部品の半田付け工程で多用されているロジン系フラックスに対する溶解能が高いため、フラックス洗浄剤として舒適な物質である。ベンジルアルコールはテルベン系洗浄剤と異なり、ほとんど無臭であるため、防臭対策が不要であり、クリーンルームなどの閉鎖空間での取り扱いも容易である。また、ベンジルアルコールは炭化水業系洗浄剤と異なり、引火点が高い(96七)ため、防災上の

フラックスの洗浄効率をさらに向上させる方法 に、半田付け後の電子部品をペンジルアルコール 中に浸漬し、続いてイソプロピルアルコール(Ⅰ PA) 中に浸漬する方法がある。 半田付け後の電 子部品に付着しているフラックス残渣中には、フ ラックスの主成分であるロジン (松脂) の他、ロ ジン中に含まれるアピェチン酸と半田成分のSn とが反応してできたアピエチン酸スズ(白色残渣 と呼ばれる)が含まれているが、このアピェチン 酸スズに対する溶解能は、ベンジルアルコールよ りも「PAの方が高い。従って、上記二種のアル コールを併用してフラックス洗浄を行うことによ り、ペンジルアルコール単独の場合に比べて洗浄 効率が向上する。この場合、半田付け後の電子部 品をあらかじめIPA中に浸漬した後にペンジル アルコール中に浸漬した場合でも同様の効果が得 られるが、IPAはペンジルアルコールに比べて 蒸気圧が高く、しかも表面張力が小さいため、フ ラックス洗浄後の電子部品の表面に被着した洗浄 被の蒸発速度は、ペンジルアルコールよりもJP

Aの方が大きい。従って、フラックス洗浄後、電子部品の表面に被着した洗浄液を除去するための乾燥処理を短時間で行うためには、半田付け後の電子部品を先にベンジルアルコール中に浸漬し、その後 IPA中に浸漬することによって、電子部品の表面のベンジルアルコールを IPA で置換する方がよい。

マンジルアルコールを用いて電子部品のフラット
クス洗浄を行った後、電子部品の表面に被着した
ペンジルアルコールを速やかに除去するにはは、I
PA蒸気乾燥を行うとよい。IPAは、ペンジルアルコールと任意の割合で混合し、しかも表面になってルカーに比べてラットと
たよく、しかも表面の表面に被着したペンジルアル
たみく、しかも表面の表面に被着したペンジルアル
たみとの電子部品の乾燥時間を短縮することが
できる。

このように、ペンジルアルコールとIPAとを 併用してフラックス洗浄を行うことにより、ペン

燥処理槽 2 2 が設置されている。第一洗浄槽 5 にはペンジルアルコールが、また第二洗浄槽 6 および置換槽 7 にはIPAがそれぞれ充填されている。

第一洗浄槽 5 に接続された自動薬被供給ユニット 8 からは、所定量のベンジルアルコールが第一洗浄槽 5 に自動供給されるようになっている。また第一洗浄槽 5 からオーバーフローしたベンジルアルコールは、フィルタ 9 、ポンプ 1 0 およびにータ 1 1 を備えた循環濾過ユニット 1 2 を通って精浄化された後、第一洗浄槽 5 に戻るようになっている。第一洗浄槽 5 内のベンジルアルコールは 6 0~7 0 セ程度に加熱されている。

第二洗浄槽 6 および置換槽 7 には、それぞれの槽に接続された自動薬液供給ユニット 8 から所定量の I P A が自動供給されるようになっており、またそれぞれの情からオーバーフローした I P A は、循環濾過ユニット 1 2 を通って清浄化された後、それぞれの槽に戻るようになっている。第二洗浄槽 6 および置換槽 7 内の I P A は 6 0 ~ 7 0 て程度に加熱されている。

ジルアルコール単独の場合に比べて洗浄効率が高に比べて洗浄効率が高に出る。また、ベンジルアルコールを用いて気気を用いた後、「PA装色を行った後、「PA装色をできる。したができる。とができる。というでは、「PAは、「PAは、「PAは、「PAは、「PA以外の有機をいったい」では、「PA以外の有機を対してもよい。

以下、本発明のフラックス洗浄剤を用いた半田付け電子部品の洗浄方法の一例を実施例により以明する。

(実施例)

第1図は、本実施例で使用する洗浄装置1の银 略図である。

洗浄装置 1 は、ロード室 2 、洗浄乾燥室 3 およびアンロード室 4 からなる。洗浄乾燥室 3 内には、第一洗浄槽 5 、第二洗浄槽 6 、置換槽 7 および乾

上記3つの槽5.6.7のそれぞれの底部には 超音波発援装置13が設置され、それぞれの槽内 のアルコールを超音波振動させるようになってい る。

乾燥処理槽222内の底部には1PAが充填されている。1PAはヒータ14によって沸点温度(82.7℃)まで加熱され、気化した1PAの蒸気は冷却管15によって冷却、液化された後、乾燥処理槽22内の底部に戻るようになっている。

次に、上記洗浄装置を用いた電子部品の洗浄方法を第2図に示すフローに従って説明する。

まず第3図(a)に示す基板16を用意し、その主面のマウントバッド17上にスクリーン印刷法を用いて半田ペースト18を塗布し、続いて半田ペースト18の表面にロジン系のフラックス19を塗布する。次に、第3図(b)に示すように、上記マウントバッド17上にしる「バッケージ20の外部端子(リード)21を搭載した後、基板16をリフロー炉に搬送し、半田ペースト18を加熱、格数することによって、しる「バッケージ20を

基板16上に半田付けする。

次に、上記半田リフロー工程が完了した基板16を前記洗浄装置1のロード室2に搬入し、続いて図示しない自動搬送ユニットを用いて洗浄乾燥室3に搬入する。そしてまず、基板16を第一洗浄槽5のベンジルアルコール中に数分間浸漬し、引き続き第二洗浄槽6の1PA中に数分間浸漬することによって、基板16の表面に残留したフラックス残渣を完全に溶解、除去する。

次に、基板16を置換槽7のIPA中に浸漬し、 その表面を清浄な!PAで置換し、最後に乾燥処理槽22内でIPA蒸気乾燥を行うことにより、 フラックス洗浄工程が完了する。

以上、本発明者によってなされた発明を実施例に基づき具体的に説明したが、本発明は前記実施例に限定されるものではなく、その要旨を逸脱しない範囲で種々変更可能であることはいうまでもない。

前記実施例では、LSIパッケージを実装した 基板のフラックス洗浄に適用した場合について説

行った後、上記半田付け電子部品をIPAで蒸気 乾燥することにより、その表面に被着したフラッ クス洗浄剤を速やかに除去することができる。

4. 図面の簡単な説明

第1 図は、本発明の一実施例であるフラックス 洗浄方法において用いる洗浄装置の概略図、

第2図は、このフラックス洗浄方法を工程順に 示すフロー図、

第3図(a)、(b)は、このフラックス洗浄方法の適 用対象である基板の要部概略図である。

明したが、これに限定されるものではなく、各種 半田付け部品のフラックス洗浄に広く適用することができる。

〔発明の効果〕

本朝において開示される発明のうち代表的なものによって得られる効果を簡単に説明すれば、下記の通りである。

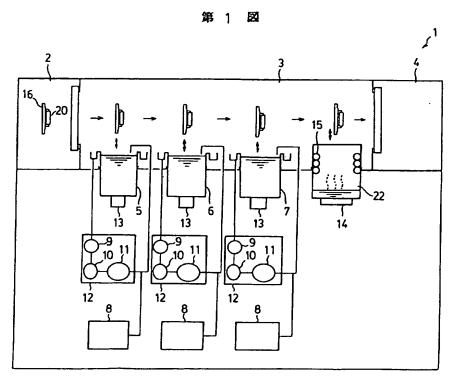
(1) . ペンジルアルコールからなるフラックス洗浄 別を用いることにより、半田付け後の電子部品に 付着したフラックスを有効に除去することができ る。またペンジルアルコールは、ほとんど無臭で あるため、防臭対策が不要であり、かつ引火点が 高いため、防災上の見地からも取り扱いが容易で、 安全性が高い。

(2). ベンジルアルコールからなるフラックス洗浄 刺を用いて半田付け電子部品のフラックス洗浄を 行う際、1PAを併用することにより、フラック ス洗浄効率を向上させることができる。

(3). ベンジルアルコールからなるフラックス洗浄 刻を用いて半田付け電子部品のフラックス洗浄を

・・乾燥処理槽。

代理人 弁理士 筒 井 大 和

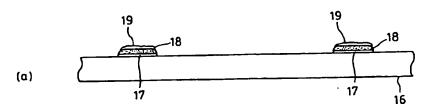


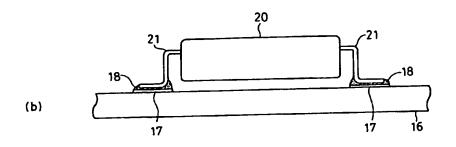
1:洗浄装置 5,6:洗浄槽 22:乾燥処理槽

第 2 図

フラックス塗布
↓
パッケージ搭載
↓
半田リフロー
↓
ベンジルアルコール
洗浄
↓
I P A 洗浄
↓

第 3 図





16:基板 19:フラックス

第1頁の続き			
@発明者	林 田	哲 哉	東京都青梅市今井2326番地 株式会社日立製作所デバイス
			開発センタ内
@発明者	佐藤	俊 彦	東京都青梅市今井2326番地 株式会社日立製作所デバイス
			開発センタ内
@ 発 明 者	舘	宏	東京都小平市上水本町5丁目20番1号 日立超エル・エ
			ス・アイ・エンジニアリング株式会社内

This Page is Inserted by IFW Indexing and Scanning Operations and is not part of the Official Record

BEST AVAILABLE IMAGES

Defective images within this document are accurate representations of the original documents submitted by the applicant.

Defects in the images include but are not limited to the items checked:			
	☐ BLACK BORDERS		
	☐ IMAGE CUT OFF AT TOP, BOTTOM OR SIDES		
	☐ FADED TEXT OR DRAWING		
	☐ BLURRED OR ILLEGIBLE TEXT OR DRAWING		
	☐ SKEWED/SLANTED IMAGES		
	☐ COLOR OR BLACK AND WHITE PHOTOGRAPHS		
	☐ GRAY SCALE DOCUMENTS		
	☐ LINES OR MARKS ON ORIGINAL DOCUMENT		
	☐ REFERENCE(S) OR EXHIBIT(S) SUBMITTED ARE POOR QUALITY		

IMAGES ARE BEST AVAILABLE COPY.

☐ OTHER: ____

As rescanning these documents will not correct the image problems checked, please do not report these problems to the IFW Image Problem Mailbox.